

*Поправки к статье***Влияние температуры отжига на кинетику процесса алюминий-индуцированной кристаллизации тонких пленок аморфного субоксида кремния**

© И.Е. Меркулова, А.О. Замчий, Н.А. Лунев, В.О. Константинов, Е.А. Баранов

В статье, опубликованной в журнале „Письма в Журнал технической физики“ (2021, том 47, вып. 21, с. 39–42. DOI: 10.21883/PJTF.2021.21.51628.18874), была допущена ошибка при указании коэффициента стехиометрии  $x$  пленок  $a\text{-SiO}_x$ . В работе указано значение 0.25, которое было получено из спектров пропускания инфракрасного (ИК) диапазона. Более точные измерения, проведенные с помощью методов рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии, показали, что значение коэффициента стехиометрии  $x$  исходных пленок  $a\text{-SiO}_x$  составляет 0.9. Кроме того, это позволило уточнить коэффициент пропорциональности, применяемый для определения концентрации связанного кислорода в  $a\text{-SiO}_x$  методом ИК фурье-спектроскопии [1].

Так:

на с. 39, строка 2 аннотации написано: „... кремния  $a\text{-SiO}_{0.25}$  для температур отжига...“, должно быть: „... кремния  $a\text{-SiO}_{0.9}$  для температур отжига...“;

на с. 39, строка 7 аннотации написано: „... кристаллизации  $a\text{-SiO}_{0.25}$ , которое...“, должно быть: „... кристаллизации  $a\text{-SiO}_{0.9}$ , которое...“;

на с. 39, строки 10–11 сверху в правой колонке написано: „... стехиометрический коэффициент исходных пленок с  $x = 0.25$  [7]“, должно быть: „... стехиометрический коэффициент исходных пленок —  $x = 0.9$  [7]“;

на с. 39, строка 20 сверху в правой колонке написано: „... слоев кварц/ $a\text{-SiO}_{0.25}$ / $a\text{-SiO}_2$ /Al...“, должно быть: „... слоев кварц/ $a\text{-SiO}_{0.9}$ / $a\text{-SiO}_2$ /Al...“;

на с. 41, строки 18–19 сверху в правой колонке написано: „... процесса АИС  $a\text{-SiO}_{0.25}$ , которая...“, должно быть: „... процесса АИС  $a\text{-SiO}_{0.9}$ , которая...“;

на с. 41, строка 25 сверху в правой колонке написано: „... нестехиометрического оксида кремния  $a\text{-SiO}_{0.25}$ ...“, должно быть: „... нестехиометрического оксида кремния  $a\text{-SiO}_{0.9}$ ...“;

на с. 41, строка 33 сверху в правой колонке написано: „... процесса АИС  $a\text{-SiO}_{0.25}$ ...“, должно быть: „... процесса АИС  $a\text{-SiO}_{0.9}$ ...“.

Эти исправления не сказываются на выводах указанной работы.

**Список литературы**

[1] A.O. Zamchiy, E.A. Baranov, I.E. Merkulova, S.Y. Khmel, E.A. Maximovskiy, J. Non-Cryst. Solids, **518**, 43 (2019). DOI: 10.1016/j.jnoncrsol.2019.05.015